

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第3部門第3区分
 【発行日】令和7年6月2日(2025.6.2)

【国際公開番号】WO2023/021946
 【出願番号】特願2023-542295(P2023-542295)

【国際特許分類】
 C 0 8 L 2 1 / 0 2 (2 0 0 6 . 0 1)
 C 0 8 K 5 / 4 2 (2 0 0 6 . 0 1)

【 F I 】
 C 0 8 L 2 1 / 0 2
 C 0 8 K 5 / 4 2

10

【手続補正書】
 【提出日】令和7年5月23日(2025.5.23)

【手続補正1】
 【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

20

【特許請求の範囲】

【請求項1】

重合体のラテックスとアニオン性界面活性剤とを含有するディップ成形用ラテックス組成物であって、

前記アニオン性界面活性剤が、アニオン性基を1個有し芳香環を有する化合物(a)と、アニオン性基を2個以上有しベンゼン環を有する化合物(b1)またはアニオン性基を1個有し芳香環を有さない化合物(b2)と、を含有するディップ成形用ラテックス組成物。

【請求項2】

前記化合物(b1)が、アニオン性基を2個有しベンゼン環を有する化合物である請求項1に記載のディップ成形用ラテックス組成物。

30

【請求項3】

前記化合物(b1)が、アルキルジフェニルエーテルジスルホン酸塩である請求項1または2に記載のディップ成形用ラテックス組成物。

【請求項4】

前記化合物(b2)が、アルキル硫酸エステル塩である請求項1または2に記載のディップ成形用ラテックス組成物。

【請求項5】

前記化合物(a)が、スルホン酸塩または硫酸エステル塩であり、かつ、前記化合物(b1)または前記化合物(b2)の少なくとも一方が、スルホン酸塩または硫酸エステル塩である請求項1または2に記載のディップ成形用ラテックス組成物。

40

【請求項6】

前記化合物(a)が、アルキルベンゼンスルホン酸塩である請求項1または2に記載のディップ成形用ラテックス組成物。

【請求項7】

化合物(a)の含有量が、ディップ成形用ラテックス組成物中に含まれる重合体成分100重量部に対して、0.1~5.0重量部である請求項1または2に記載のディップ成形用ラテックス組成物。

【請求項8】

化合物(b1)の含有量と化合物(b2)の含有量の合計が、ディップ成形用ラテック

50

ス組成物中に含まれる重合体成分100重量部に対して、0.1～10.0重量部である請求項1または2に記載のディップ成形用ラテックス組成物。

【請求項9】

化合物(a)の含有量と、化合物(b1)および化合物(b2)の合計の含有量の重量比〔化合物(a)の重量：化合物(b1)および化合物(b2)の合計の重量〕が、5：95～95：5である請求項1または2に記載のディップ成形用ラテックス組成物。

【請求項10】

前記重合体のラテックスが、ニトリル基含有共役ジエン系重合体のラテックスである請求項1または2に記載のディップ成形用ラテックス組成物。

【請求項11】

請求項1または2に記載のディップ成形用ラテックス組成物を用いてなるディップ成形体。

【請求項12】

手袋である請求項11に記載のディップ成形体。

10

20

30

40

50